# Исследование возможности использования защитных антибарьерных слоев Ті и Со в поляризационной нейтронной оптике

<u>Матвеев В.А.,</u> Плешанов Н.К.

Петербургский институт ядерной физики, Гатчина

#### Структура поляризующего суперзеркала







Области с нулевой намагниченностью (магнитно-мертвые слои) и окисный слой формируют потенциальные барьеры от которых отражаются нейтроны обоих направлений спина. Это приводит к снижению поляризации отраженного от покрытия нейтронного пучка.



# Антибарьерные слои

В работе [1] было показано, что если рядом с барьером разместить яму толщиной :

$$a = -\frac{V_b}{V_a}b$$
или  $\langle V \rangle = \frac{V_a a + V_b b}{a + b} = 0$   
то для  $bq_b <<1$  коэффициент отражения нейтронов  
с  $q \to 0$ :  
 $R \cong \frac{1}{64} \left[ bq_b \left( 1 + \left( \frac{q_b}{|q_a|} \right)^2 \right) \right]^2 <<1$ 

 $q_a = \sqrt{8m_n |V_a|} / \hbar$ 

 $q_b = \sqrt{8m_nV_b} / \hbar$  -критическое значение переданного импульса для материала барьера

Слои с отрицательными потенциалом, позволяющие уменьшить отражение нейтронов от потенциальных барьеров, получили называние <u>антибарьерных</u>. Размещая антибарьерные прослойки рядом с магнитно-мертвыми и оксидными слоями можно существенно снизить отражение нейтронов от данных структурных несовершенств. Основными претендентами на роль материала для антибарьерных слоев являются титан и кобальт.

<sup>1.</sup> Pleshanov N.K. // Nucl. Instrum. Methods A. 2010. V. 613. №1. 15-22.



отражения от «идеального» суперзеркала с поглощающим подслоем; 4 – расчет отражения «идеального» суперзеркала с рассогласованными потенциалами соседних слоев; 5 – расчет отражения от суперзеркала с антибарьерными слоями Ті.

1. Pleshanov N.K. // Nucl. Instrum. Methods A. 2010. V. 613. №1. 15-22.

# Цель и задачи работы

<u>Целью работы</u>: является исследование окисления нанослоев Ті и Со при нормальных условиях, а также изучение возможности их использования для улучшения поляризующих нейтронных покрытий.

#### <u>Задачи</u>:

1. Исследование структуры тонких слоев Ті и Со подвергнутых окислению на воздухе при н.у.

2. Исследование долговременной стабильности нанослоев Ті и Со.

3. Оценка оптимальных толщин слоев Ті и Со, необходимых для их использования в качестве антибарьерного покрытия

4. Экспериментальная проверка возможности использования нанослоев Ті и Со для улучшения поляризующей эффективности нейтронных зеркал.

#### Образцы и методы исследования

Образцы для исследований:

Тонкие слои Ті и Со толщиной 5-100 нм, нанесенные на стеклянные подложки. Образцы изготавливались методом магнетронного напыления на установке ЛУНА (ФГБУ "ПИЯФ", Гатчина). Рабочее давление аргона при напылении составляло 2.5·10<sup>-3</sup> мбар, а давление остаточных газов до напыления 5·10<sup>-5</sup> мбар.

Материал мишени: технически чистый титан (ТГ-90) и кобальт; подложка – флоат-стекло толщиной 5 мм.

<u>Основные методы исследования</u>: нейтронная и рентгеновская рефлектометрия. Дополнительно образцы исследовались методами AFM, GiSAXS, стандартным четырехконтактным методом.

Результаты дополнительных исследования позволили установить, что нанослои Ті и Со, получаемые с помощью магнетронного напыления, являются достаточно однородными и сплошными [2,3].

2. Матвеев В.А., Плешанов Н.К., и др. // Поверхность рент., синхр. и нейтр. исслед. 2014. № 10. с. 34.

3. Геращенко О.В., Матвеев В.А., и др. // ФТТ. 2014. № 7. с. 1386.

# Нейтронная рефлектометрия

#### Рефлектометр НР-4М (ПИЯФ, Гатчина)



Схема рефлектометра НР-4М: (1) внутриканальный коллиматор, (2) монитор,

(3) суперзеркальный отклонитель пучка,

(4) коллиматор, (5) прерыватель пучка,

(6) формирователь пучка в постоянном магните, (7) флиппер Корнеева,

(8) Сd диафрагмы, (9) узел образца с постоянным магнитом, (10) образец,

(11) радиочастотный адиабатический спин-флиппер, (12) суперзеркальный
14 CoFeV/TiZr анализатор в постоянном магните, (13) диафрагма детектора, (14) Не детектор.

Основные параметры рефлектометра HP-4M: максимальный диапазон длин волн λ: 0.5 разрешение по длине волны Δλ/λ: 0.0 плотность потока нейтронов на образце: 7.5 интегр. поляризация нейтронного пучка: 99%

```
0.5÷5 Å
0.05
7.5·10<sup>4</sup> имп·сек<sup>-1</sup>·см<sup>-2</sup>
99%
```

## Нейтронная рефлектометрия

Рефлектометр РЕФЛЕКС (ОИЯИ, Дубна)



Схема рефлектометра РЕФЛЕКС: (1) замедлитель нейтронов, (2) прерыватель пучка, (3) коллиматоры, (4) вакуумированная труба, (5), суперзеркальный поляризатор, (6) постоянные магниты, (7) первый флиппер, (8) узел образца с электромагнитом, (9) второй флиппер, (10) анализатор, (11) ПЧД-детектор, (12) управляющий компьютер с блоком управляющей электроники.

Основные параметры рефлектометра РЕФЛЕКС:<br/>максимальный диапазон длин волн λ:0.5÷10 Åразрешение по длине волны Δλ/λ:0.02плотность потока нейтронов на образце:~10<sup>5</sup> имп·сек<sup>-1.</sup>см<sup>-2</sup>

#### Рентгеновская рефлектометрия

Схема дифрактометрического комплекса Rigaku Smartlab (КИ, Москва) в рефлектометрической моде



Основные параметры: длина волны λ: разрешение по длине волны Δλ/λ: интенсивност, на образце: угловая расходимост, тичка Δθ:

1.54 Å (CuKα) 0.01 10<sup>8</sup> имп·сек<sup>-1</sup>·см<sup>-2</sup> 0.5 угл. мин.

#### Исследование нанослоев Ti: XRR, NRR



#### Исследование нанослоев Ti: XRR, NRR



#### Исследование нанослоев Co: NRR





Экспериментально найденная зависимость толщины слоя оксида *d*[TiO<sub>2</sub>] от исходной толщины титановой пленки *d*<sub>0</sub>[Ti] может быть описана достаточно простой эмпирической функцией:

$$d[\text{TiO}_2] = d_{\min}[\text{TiO}_2] + \exp\left(-\frac{d_0[\text{Ti}] - 23.4}{19.2}\right)$$
 где  $d_{\min}[\text{TiO}_2] = 2.4$  нм

Для случая окисления тонких слоев Со, толщина оксидного слоя практически не зависит от исходной толщины Со слоя и составляет величину:

## Исследование стабильности нанослоя Ті



Зависимости коэффициентов отражения нейтронов *R* от переданного волнового вектора *q* нанослоя Ti 10 нм, измеренные после окисления на воздухе за различные промежутки времени.

Для исследования стабильности нанослой Ті выдерживался на воздухе, при комнатной температуре, в течении 80 и 270 дней. После каждого этапа выдержки образцы изучались методом рефлектометрии поляризованных нейтронов. Измерения показали высокую стабильность не окисленного слоя Ті, что важно для практического применения в поляризационной оптике.

#### Исследование стабильности нанослоя Со



Зависимости коэффициентов отражения нейтронов с спином «вверх» R и «вниз» от переданного волнового вектора *q* нанослоев Ti и Co, измеренных после окисления на воздухе за различные промежутки времени.

Для исследования стабильности нанослои Со выдерживались на воздухе, при комнатной температуре, в течении 100 и 700 суток. После каждого этапа выдержки образцы изучались методом рефлектометрии поляризованных нейтронов. Измерения показали высокую стабильность не окисленного слоя Со.

## Оценка оптимальной толщины нанослоя Ті



Зависимость толщины оксидного слоя от исходной толщины слоя Ті.

Зависимость величины среднего оптического потенциала от исходной толщины слоя Ті.

Необходимая исходная толщина слоя Ті может быть найдена из условия равенства нулю среднего потенциала системы «яма-барьер»:

## Оценка оптимальной толщины нанослоя Со



Зависимость толщины оксидного слоя от исходной толщины слоя Ті.

Зависимость величины среднего оптического потенциала от исходной толщины слоя Ti.

Необходимую исходную толщину слоя Со также можно оценить из условия:

Поляризующее зеркало



#### Поляризующее зеркало без оксидного слоя



Расчетный глубинный профиль оптического потенциала для нейтронов со спином «вниз»

# Экспериментальная проверка возможности использования нанослоев Ті и Со для улучшения поляризующих нейтронных зеркал.

Образцы для исследований:

Поляризующие зеркала FeCo/TiZrGd с нанесенными верхними нанослоями Ti и Co.



Метод исследования:

Рефлектометрия поляризованных нейтронов (НР-4М, ПИЯФ и V6, НМІ).

# Поляризующее зеркало с антибарьерным слоем - TiZrGd - FeCo -оксид FeCo - Ti, Co - TiO<sub>2</sub>, CoO Substrate Substrate V-V-

#### Поляризующие зеркала с антибарьерными Ті слоями



#### Поляризующие зеркала с антибарьерными Со слоями



#### Основные результаты

- Установлено, что при комнатных температурах толщина оксида, формирующегося на поверхности слоев Ті толщиной от 5 до 100 нм, получаемых методом магнетронного напыления, зависит от исходной толщины титана. В тоже время толщина окисной пленки, образующейся на слоях Со при тех же условиях окисления практически не зависит от исходной толщины кобальта и составляет величину ~2.8 нм.
- В процессе длительного окисления на воздухе металлический слой сохраняется даже у самых тонких слоев Ті и Со (с исходными толщинами ~5 нм), что свидетельствует о возможности их использования в качестве антибарьерных слоев.
- Установлено, что формируемый слой оксида, стабилен при комнатных температурах в течение довольно продолжительного времени.
- Из данных об окислении получены оценки оптимальных исходных толщин верхних антибарьерных слоев Ті (8.8 нм) и Со (9.9 нм) необходимых для улучшения поляризующих покрытий.
- Впервые экспериментально проверен эффекта подавления отражения нейтронов верхним антибарьерным слоем.

# Благодарю за внимание!